Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

: 07299586

PUBLICATION DATE

14-11-95

APPLICATION DATE

: 02-05-94

APPLICATION NUMBER

: 06113425

APPLICANT: NIPPON STEEL CORP;

INVENTOR: SATO SOHEI;

INT.CL.

: B23K 35/30 C22C 38/00 C22C 38/44

TITLE

: WIRE FOR GAS METAL ARC WELDING FOR AUSTENITE STAINLESS STEEL

ABSTRACT: PURPOSE: To improve arc stability in welding with a low oxygen contained Ar gas and to

suppress generation of oxidized scale, blow holes and spatters, in the gas metal arc

welding for austenite system stainless steel.

CONSTITUTION: The welding wire is such that the quantities of C, Si, Mn, S, AI, Cr, Ni and Mo are stipulated, that Li: 0.001-0.01% and if necessary, Ti: 0.01-0.1% are contained,

that O, Ca and Mg are regulated to be each specific quantity or less, and that the

remainder is constituted of Fe and unavoidable impurities.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-299586

(43)公開日 平成7年(1995)11月14日

(51) Int.Cl.6

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

B 2 3 K 35/30 C 2 2 C 38/00 320 B 302 S

38/44

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平6-113425

(71)出願人 000006655

新日本製鐵株式会社

(22)出願日

平成6年(1994)5月2日

東京都千代田区大手町2丁目6番3号

(72)発明者 佐藤 荘平

千葉県富津市新富20-1 新日本製鐵株式

会社技術開発本部内

(74)代理人 弁理士 萩原 康弘 (外1名)

(54) 【発明の名称】 オーステナイトステンレス鋼用ガスメタルアーク溶接ワイヤ

(57)【要約】

【目的】 オーステナイト系ステンレス鋼のガスメタルアーク溶接において、2%以下の低酸素量含有Arガスによる溶接時のアーク安定性を改善し、酸化スケールやプローホール、スパッタの発生を抑えることを目的とする。

【構成】 C、Si、Mn、S、AI、Cr、Ni、M o量を規定するほか、Li:0.001~0.01%、必要に応じ、Ti:0.01~0.1%を含有し、O、Ca、Mgを一定量以下に規制し、残部がFeおよび不可避的不純物からなることを特徴とするオーステナイトステンレス鋼用ガスメタルアーク溶接ワイヤ。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 重量%で、

 $C : 0.015 \sim 0.15\%$

S1:0.2~1.0%

Mn:1.0~3.0%

 $S : 0.004 \sim 0.015\%$

A1:0.002~0.01%

Cr:11~32%

 $Ni:3.0\sim22.5\%$

Mo: 0. 001~4%

Li:0.001~0.01%を含有し、

〇 : 0. 01%以下

Ca:0.005%以下

Mg: 0.005%以下に規制し、残部がFeおよび不 可避的不純物からなることを特徴とするオーステナイト ステンレス鋼用ガスメタルアーク溶接ワイヤ。

【請求項2】 さらに重量%で、

Ti:0.01~0.1%を含有することを特徴とする 請求項1記載のオーステナイトステンレス鋼用ガスメタ ルアーク溶接ワイヤ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、オーステナイトステン レス鋼のガスシールドアーク溶接において酸素含有量の 少ないシールドガスを使用しても溶接作業性が良好なガ スメタルアーク溶接ワイヤに関するものである。

[0002]

【従来の技術】ステンレス鋼のガスメタルアーク溶接に は、そのシールドガスとしてアークの安定性を確保する 理由から、Arガスに1~5%の酸素を添加したガスを 30 使用している。実際の使用状況として5%添加では、溶 接ビード上の酸化スケールの発生が著しく、多層盛り溶 接では、グラインダなどで酸化スケールを削除しながら 溶接しなければならず作業効率が著しく低下する。さら に、酸素はプローホールを発生させ溶接欠陥の原因とな る。

【0003】また1%程度の酸素ではアークを安定させ るのは難しく、スパッタを発生しやすくするので、2% 程度を含有したものを使用する場合が多かった。しか し、この2%酸素含有Arガスも5%と同様な溶接ビー ド上の酸化スケールの発生、ブローホールの発生などの 問題があった。現在の状況をまとめると、高品質ガスシ ールドアーク溶接をおこなうには酸素含有量が少ない方 が良く、アーク安定性を確保するには酸素含有量が多い 方が良いということになる。

【0004】しかしながら、酸素含有量が多いシールド ガスを使用してもアーク安定性が劣るワイヤもあり、単 に酸素含有量だけがアーク安定性を決める要素ではな い。現在では、同一条件で溶接を行った時にほぼ同様な 主要成分のワイヤ間でアーク安定性に差が出る理由とし 50 【0009】

て、ワイヤの微量成分、特にAlの添加量が多いほどア ーク安定性が悪化することが公知である。つまり、溶接 材料メーカー各社のステンレス鋼用溶接ワイヤの特許出 願の中で、Alの添加量を規制することで、アーク安定 性が向上することが記載されている。Alはワイヤの素 材を溶解して作るときに脱酸剤として使用するため、量 の差はあれどのようなワイヤでも含まれる。

2

【0005】A1添加量の変化はアーク安定性、特に溶 滴の移行特性に大きな影響を及ばす。 図1は溶接ワイヤ 10 先端の溶滴移行状態を示す図で、Alの添加量が多くア ーク安定性が劣るワイヤの場合である。 図1のように溶 滴2が涙滴状になり、母材側のプール4に対して途切れ 途切れに移行することになり、溶滴が移行した時、その 勢いでスパッタを発生させる。この時の溶接ビードは、 蛇行が見られ均一性が失われる。 なお図中1 は溶接ワイ ヤ、3はアークである。

【0006】図2は図1と同様の図であるが、A1の添 加量が少なくアーク安定性が良好なワイヤの場合であ る。溶滴5は涙滴状にはならず、溶けるそばから母材の プール4に流れ落ち安定した移行を行う。連続した移行 であるので、スパッタの発生は無く、溶接ビードは安定 する。

【0007】これら違いが生じる理由を以下に述べる。 ステンレス鋼の場合、安定なCr酸化被膜が材料表面に 形成され、これが保護被膜の役割をはたし、高い耐腐食 性を発揮している。溶接時においてこのCr酸化被膜 は、酸素を含有したシールドガスによって、アークによ って溶かされた溶融ワイヤ最表面にすでに発生してお り、溶融ワイヤの表面に表面張力を発生させる。しか し、溶融ワイヤの表面を覆うように完全に形成されてい ないので涙滴状にはならず流動性は確保される。しかし A 1 の微量添加により保護皮膜はさらに短時間で強固な 皮膜を形成させる。このため、溶滴の表面の表面張力は 増大するため、涙滴状になりやすくなる。A I の添加量 が多いほどこの傾向は強い。

【0008】このような違いは薄板(板厚2mm以下) の溶接で使用する、短絡移行域での溶接で大きな影響を およぼす。薄板の場合、高電流で溶接すると板が溶け落 ちてしまうため、電流を下げ(少なくとも150A以 下)、さらに電圧を下げてアーク長を短くし、溶滴を細 かいピッチで母材に付けながら短絡移行溶接をおこな う。この時、溶滴表面にCrの酸化被膜が形成されると 酸化被膜による電気伝導性の悪化により、アークが発生 しにくくなりアーク状態を不安定にし、溶滴先端(アー クが発生していなければワイヤ先端) が母材と接触した ときにスパークを発生しこの時大粒のスパッタを発生す る。短絡移行の場合、この状態は特に深刻で、溶滴を主 とした溶融部分が瞬時に吹き飛んでしまうために、アー クが途切れてしまう場合がある。

【発明が解決しようとする課題】本発明は以上のような 事情に鑑み、2%以下の低酸素量含有Arガスによる溶 接時のアーク安定性を改善し、酸化スケールやプローホ ール、スパッタの発生を抑えることを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は前記課題を解決 するものであって、重量%で、C:0.015~0.1 5%, Si: 0. $2 \sim 1$. 0%, Mn: 1. $0 \sim 3$. 0%, S: 0. $004\sim0$. 015%, A1: 0. 00 $2 \sim 0.01\%$, Cr: $11 \sim 32\%$, Ni: 3.0 ~ 10 22. 5%, Mo: 0. 001~4%, Li: 0. 00 1~0.01%、必要に応じ、Ti:0.01~0.1 %を含有し、O:0.01%以下、Ca:0.005% 以下、Mg:0.005%以下に規制し、残部がFeお よび不可避的不純物からなることを特徴とするオーステ ナイトステンレス鋼用ガスメタルアーク溶接ワイヤであ る。

[0011]

【作用】本発明は、A I を規制しL i を添加することで 表面張力と電気伝導度を制御し溶滴の流動性を向上させ ることを特徴とする。すなわちLi元素を添加すること で、ワイヤ溶融時に溶滴に生ずるCr酸化被膜の発生速 度を制御し、溶滴の流動性を確保し、優れた作業性を実 現した。

【0012】ワイヤが溶かされ溶滴になると、はじめに 初期酸化が起こる。これは、溶滴最表面に発生するごく 薄い酸化膜で外気と溶滴内部を遮断する。この時、表面 張力は溶滴の移行状態を左右するほど発生してはいな い。これ以後の酸化は、イオンの形で侵入する酸素によ って行われる。したがって、酸素分圧は低くなり、この 30 後は低い酸素分圧で酸化する元素が優位的に酸化され る。主要成分のなかではCrが選択的に酸化される。こ こにしiが添加されると、Crより低い酸素分圧で酸化 するため微量添加であっても酸素との結合力が大きい。

【0013】図3は、Cr2Osの酸化被膜を模式的に 示した図である。また、図4はLiが添加された場合の Cr₂O₃の酸化被膜を模式的に示した図である。Li 無添加の場合、図3のような密で電気的パランスのとれ たCr2 O1 が発生し強固な酸化被膜を形成しこれ以上 の酸化は止まる。これに対しLiが添加されるとLiが Cr₂ O₃ に固溶した形で酸化被膜を形成するため電気 的パランスが崩れ、密な酸化被膜の形成は遅れる。Cr の酸化速度は減じられ、また溶滴全体を被膜が覆うよう な完全な形成は遅れる。この結果、溶滴の流動性は確保 され、またCT酸化被膜形成による電気伝導度の悪化か ら逃れることができる。

【0014】以上のような効果は、さらに酸素分圧の低 い、したがってシールドガス内の酸素含有量が少ない場 合には、強調されることになる。酸素含有量が少ないシ

ブローホールの少ない溶接が可能になる。以下に本発明 ワイヤの各成分の作用を示す。

【0015】C:Cは強度を高めるために0.015% 以上添加するが、添加しすぎると炭化物を発生させ靱性 を低下させる。よって0.15%以下とする。

【0016】Si:溶滴の表面張力を抑える効果がある ので 0. 2%以上添加するが、溶接金属の強度低下を招 きやすく1.0%以下とする。

【0017】Mn:脱酸、脱硫剤として1.0%以上添 加するが、多すぎると耐食性、耐酸化性が劣化するので 3. 0%以下とする。

【0018】S:溶繭の表面張力を下げる効果がある が、0.004%未満ではその効果が小さく、また0. 015%超では粒界などに硫化物を生成する可能性があ るので、0.004%~0.015%とする。

【0019】A1:脱酸剤として添加されるが溶滴の移 行特性に最も影響が大きく、脱酸剤として最低量の0. 002%程度でも溶滴の酸化被膜を強化して玉状の溶滴 にする。過剰な添加は溶滴移行を害するので0.01% 以下とする。

【0020】 Cr:ステンレス鋼の必須成分で、不動態 皮膜を形成し、耐酸化性、耐食性を向上させるが、11 %未満では、その特性が十分に保持できず、32%を超 えるとシグマ相の晶出が起こりやすく、ワイヤ製造工程 において加工性が劣化するので、11%~32%とす

【0021】Ni:オーステナイト生成元素でオーステ ナイトを安定化させ、耐食性、靱性を向上させるため 3. 0%以上添加するが、加工性が劣化するので、2 2. 5%以下とする。

【0022】Mo:組織を強化し、耐食性およびクリー ブ強度を向上させるため0.001%以上添加するが、 4%を超えるとシグマ相の生成を助長させ、延性が低下 し、ワイヤ製造工程において加工性が劣化するので、4 %以下とする。

【0023】Li:LiはCrの酸化被膜の間に入り、 酸化速度を減少させるため酸化被膜による溶滴移行の阻 害が抑えられ、またCrの酸化被膜を未完成とすること により電気伝導性が向上する。しかし、添加量が多すぎ るとCr酸化被膜による耐食性を劣化させるため添加量 に限界があり0.001~0.01%とする。

【0024】〇:〇は介在物の生成や粒界に酸化物を発 生させ粒界を弱くするため0.01%以下とする。

【0025】Ca、Mg:Ca、Mgは強酸化性であ り、溶滴の最も早い時点で酸化してスラグとなり溶滴に おける電気伝導性を不安定にするため、できる限り少な い方がよい。よってそれぞれ0.005%以下とする。

【0026】Ti:必要に応じて添加する元素である。 TiO2 は半導体酸化物としてよく知られているが、こ ールドガスを使用することができれば、金属光沢のある 50 れは酸化したときに電気伝導性が良いことを示す。ゆえ

-589-

5

にTiは0.01%以上添加すればこの効果が得られ、アーク安定性、スパッタ発生、ビード外観共に改善される。しかしあまりに多いと溶接金属の組織に影響がでるため0.1%以下とする。

[0027]

【実施例】本発明による成分のワイヤと、比較例として 用意したワイヤを、ビードオンプレートにより、溶接作 業性の比較をおこなった。この時の溶接条件を表1に示* *す。なお、シールドガスはアークを不安定にしやすくするため、酸素含有量が少ない、Ar+0.5%O2を使用した。また、電流・電圧条件は、通常の条件のほか、短絡特性を調査するため短絡移行条件も同時に実施した。

6

[0028]

【表1】

	,
溶接框性	直流逆極性(電極ブラス)
帝接姿勢	下向(ピードオンプレート)
シールドガス	Ar+0.5%0 ₂
流量	15 i/min
液接 電 洗	2 0 0 A
帝接電圧	2 4 ~ 2 6 V
短絡 溶接電流	1 2 0 A
移行 条件 密接電圧	1 4 ~ 1 6 V
溶接速度	4 0 c p m
717突出量	1 5 m m
母材	SUS304:6t × 75 v × 4001

【0029】各ワイヤの化学成分を表2に、前述の溶接 ※ **[0030]** 条件による溶接作業性の評価を表3に示す。A1~A6 *30* 【表2】 は、本発明によるワイヤである。 ※

ワイヤ記号	ワイヤの化学成分 (重量%)													
2-1 YEL-3		С	Si	Mn	Ni	Cr	Мо	s	0	A1	Ca	Mg	Тi	Li
	A 1	0.05	0. 35	1.82	9.77	19. 51	0.04	0.007	0.0074	0.002	0. 0001	0.0001	<0.002	0.009
本	A2	0. 05	0. 48	1.97	9. 80	19.86	0.05	0.005	0.0069	0.003	0. 0001	0.0001	0.090	0.008
丑	A3	0.05	0. 40	1. 96	12.40	24. 10	0.04	0.007	0.0051	0.002	0. 0001	0.0001	<0.002	0.010
π.	A4	0. 02	0. 43	1. 79	9. 87	19. 38	0.07	0.006	0. 0046	0.003	0.0001	0.0001	0.002	0.009
明	A5	0. 04	0. 35	1. 52	12. 20	19.00	2.47	0.005	0.0070	0.003	0.0001	0.0001	0.002	0.009
	A6	0. 01	0. 62	2.90	12. 80	27.30	0.99	0. 005	0.0060	0.003	0.0001	0. 0001	<0.002	0.009
ш	BI	0.05	0. 33	1. 79	9. BO	19.76	0.05	0.004	0. 0051	0.002	0.0001	0.0001	<0.002	0.0001
比较例	B2	0. 05	0. 30	1. 84	9. 90	19.77	0.05	0.005	0.0060	0. 015	0.0001	0.0001	<0.002	0.0001
DI.	B3	0.06	0. 31	1. 92	9. 90	19.85	0.05	0.005	0. 0056	0. 002	0.0026	0.0001	<0.002	0. 015

[0031]

【表3】

		容接作業性の評価										
2	イヤ記号	7-7安定性	スパット発生	短路特性	ピード外観	総合判定						
	A 1	0	0	0	0	0						
本	A 2	0	0	0	0	0						
発	A3	0	0	0	9	0						
	A 4	0	0	0	0	©						
明	A5	· ©	0	0	0	0						
	A6	0	0	0	0	0						
比較例	B1	Δ	Δ	×	0	Δ						
	B2	×	×	×	0	×						
	вз	Ø	0	6	×	×						

※7-7安定性: ②非常に良好、○良好、△やや劣る、×劣る ボーカ発生: ③まったく無い、△やや発生、×多い 短路特性: ③移行が非常に安定、△やや不安定、×不安定 ビード 外観: ③金属光沢、△灰色の酸化粧度、×黒い酸化スケール

【0032】ワイヤ記号A1は、基本成分がステンレス 鋼の代表的な汎用銘柄の成分であり、これにLiを添加 20 もので、アーク安定性、スパッタ発生、短絡特性共に非 したものである。アークの安定性は良く、スパッタの発 生はまったく無い。短絡特性も溶滴の移行状態が安定し ている。溶接後のビード外観も金属光沢があり非常に良 好である。

【0033】A2は、A1成分にさらにTiを添加した ものである。アーク安定性、スパッタ発生、ビード外観 共に良好である。この成分の場合、短絡特性が非常に良 く、A1よりもさらにスパッタの発生が少なくなる。

【0034】A3~A6は、主要成分範囲が違うもので あり、それぞれにLiを添加したもので、アーク安定性 30 できる。 は良好で、スパッタ発生はまったく無く、短絡時の移行 状態も安定している。ビード外観も金属光沢であった。

【0035】これに対し比較例B1は、汎用銘柄の成分 でAlを制限したものである。本発明に比べ、アーク安 定性が悪くなり、それにともないスパッタが発生する。 短絡特性は移行状態が不安定になり、スパッタが大粒に なる。ビード外観は、金属光沢がある。

【0036】B2は、汎用銘柄の成分にA1の含有量が 多いものである。アークは非常に不安定で上下動が大き く、また大粒のスパッタを発生する。短絡特性も移行状 40 態が非常に不安定でスパッタも大粒で大量に発生する。 総じて、B1よりも悪い。ビード外観は金属光沢であ る。

【0037】 B3は、Liを本発明よりも多く添加した 常によい。ただし、ビード外観は、灰色に酸化される。 これはCr酸化被膜の形成が遅れ、保護効果が劣ってい ると思われる。

[0038]

【発明の効果】本発明の成分構成によるワイヤにするこ とで、酸素含有量の少ないシールドガスを使用しても良 好なアーク安定性が得られ、またスパッタの少ない短絡 移行溶接ができ、効果的に酸化スケールの少ないビード が得られ、ガスメタルアーク溶接を高品質で行うことが

【図面の簡単な説明】

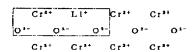
【図1】AI添加量が多い場合の溶滴移行状態を示す図 【図2】A1添加量が少ない場合の溶滴移行状態を示す X

【図3】Cr2O:の酸化被膜を模式的に示す図 【図4】Liが添加された場合のCr2O3の酸化被膜 を模式的に示す図

【符号の説明】

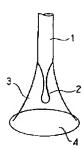
- 1 溶接ワイヤ
- 2, 5 溶滴
- 3 アーク
- 4 プール

[図4]

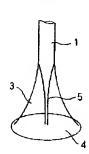


-591-

【図1】



【図2】



[図3]